ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БАРЬЕРНОЙ ЁМКОСТИ p-i-n-ФОТОДИОДОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ γ-КВАНТАМИ ⁶⁰Со

С.Б. Ластовский¹⁾, В.Б. Оджаев²⁾, А.Н. Петлицкий³⁾, В.С. Просолович²⁾, Е.В.Точилин¹⁾, Д.В. Шестовский³⁾, В.Ю. Явид²⁾, Ю.Н. Янковский²⁾

¹⁾Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, ул. П. Бровки 19, Минск 220072, Беларусь, lastov@ifttp.bas-net.by

²⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, Минск 220030, Беларусь, odzaev@bsu.by, prosolovich@bsu.by, Yavid@bsu.by, yankouski@bsu.by

³⁾ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», ул Казинца 121А, Минск 220108, Беларусь, petan@tut.by, DShestovski@integral.by

Исследовано влияние γ -излучения 60 Со на изменение барьерной ёмкости (C_6) p-i-n-фотодиодов на основе кремния. Приборы изготавливались на пластинах p-Si ориентации (100) с ρ = 1000 Ом·см, выращенных методом бестигельной зонной плавки. Область p^+ -типа создавалась имплантацией ионов B^+ в непланарную сторону пластины, области n^+ -типа — диффузией P в планарную сторону пластины. Облучение γ -квантами производилось от источника 60 Со дозами до $1,5\cdot 10^{15}$ квант/см 2 . Установлено, что в результате воздействия облучения γ -квантами при напряжении внешнего смещения $V_{06p} \le 1$ В происходит увеличение C_6 по сравнению с необлученными образцами. В то же время при V_{06p} в диапазоне от 1 В до 20 В величина C_6 после облучения снизилась по сравнению с исходной. Это обусловлено изменением в результате облучения размеров области обеднения: при напряжениях смещения менее 1 В она уменьшилась, а при V_{06p} свыше 1 В — возросла. Наблюдаемый эффект связан с изменением величины контактной разности потенциалов.

Ключевые слова: p-i-n-фотодиод; барьерная емкость; облучение γ -квантами; генерационно-рекомбинационные процессы.

PECULIARITIES OF CHANGING THE BARRIER CAPACITY OF p-i-n-PHOTODIODES UNDER IRRADIATION WITH 60 Co γ -QUANTA

S.B. Lastovskii^{1),} V.B. Odzaev²⁾, A.N. Pyatlitski³⁾, V.S. Prosolovich²⁾, E.V.Tochilin¹⁾, D.V. Shestovsky ³⁾, V.Yu. Yavid ²⁾, Y.N. Yankovsky²⁾

¹⁾Scientific-Practical Materials Research Centre, National Academy of Sciences of Belarus, 19 P. Brovki Str., 220072 Minsk, Belarus, lastov@ifttp.bas-net.by;

²⁾Belarusian State University,

4 Nezavisimosti Ave., 220030 Minsk, Belarus,
odzaev@bsu.by, prosolovich@bsu.by, Yavid@bsu.by, yankouski@bsu.by

³⁾JSC «INTEGRAL» – «INTEGRAL» Holding Managing Company,
121A Kazintsa Str., 220108 Minsk, Belarus, petan@tut.by, DShestovski@integral.by

The effect of gamma-radiation 60 Co on the change in the barrier capacity (C_b) of p-i-n photodiodes based on Si is investigated. The devices were manufactured on plates of p-Si orientation (100) with p = 1000 Ohm·cm, grown by the method of non-melting zone melting. The p⁺-type region was created by implantation of B⁺ ions into the non-planar side of the plate, the n⁺-type region was created by diffusion of P into the planar side of the plate. γ -quanta irradiation was carried out from a 60 Co source in doses up to $1.5 \cdot 10^{15}$ cm⁻². A noticeable temperature dependence of the barrier capacitance (at a frequency of 1 kHz) is observed only at bias voltages not exceeding the contact potential difference ($V_{bi} \le 1$ V). It has been established that as a result of exposure to gamma-quanta at an external bias voltage $V_R \le 1$ V, the barrier capacity increases compared to non-irradiated samples. At the same time, at V_R in the range from 1 V to 20 V, the value of the barrier capacity after irradiation decreased compared to the initial one. This is due to the change in the size of the depletion region as a result of irradiation: at bias voltages of less than 1 V, it decreased, and at V_R of more than 1 V, it increased. The observed effect is associated with a change in the magnitude of the contact potential difference due to the compensation of the main dopant in the base of the diode due to the generation of radiation defects.

Keywords: p-i-n-photodiode; barrier capacity; gamma-ray irradiation; generation-recombination processes.

Введение

*p-i-n-*фотодиодов Использование космическом пространстве в оптических межспутниковых каналах связи обуславливает воздействие на них различных видов высокоэнергетических частиц, присутствующих в солнечной радиации. Ранее было показано [1], что воздействие уизлучения на *p-i-n*-фотодиоды приводит к росту величины обратного тока и наклона его вольт-амперной характеристики. Однако, окончательно не выяснен вопрос влияния технологических (фоновых) примесей на электрофизические параметры рі-п-фотодиода при воздействии на них уквантов. В работе исследовано влияние у излучения на изменение барьерной ёмкости (C_6) p-i-n-фотодиодов на основе кремния.

Основная часть

Приборы изготавливались на пластинах *p*-Si ориентации (100) с $\rho = 1000 \text{ Ом} \cdot \text{см}$, выращенных методом бестигельной зонной плавки. Область р⁺-типа создавалась имплантацией ионов В во всю поверхность непланарной стороны пластины, области катода n^+ -типа — диффузией Р из газовой фазы в планарную сторону пластины. Измерения вольт-фарадных характеристик производились на измерителе параметров полупроводниковых приборов Agilent B1500A с зондовой станцией Cascade Summit 11000В-АР в диапазоне температур -30...70 °C с шагом 10 °C. Облучение у-квантами производилось от источника 60 Со дозами до $1.5 \cdot 10^{15}$ квант/см².

Установлено, что барьерная емкость приборов, измеренная до проведения облучения γ -квантами 60 Со, уменьшается с увеличением обратного напряжения (V_{06p}), её зависимость от приложенного обратного смещения имеет вид $1/C^2 \sim V_{06p}$, характерный для резкого ассиметричного p-n-перехода [2]. Исследования показали, что заметная температурная зависимость C_6 (на частоте f=1 к Γ ц) наблюдается только при напряжениях смещения, не превышающих контактную разность потенциалов

 $(V_{bi} \le 1 \text{ B})$. При напряжениях смещения $V_{\text{обр}} \le V_{bi}$ зависимость от толщины обедненного слоя (W) от температуры определяется температурной зависимостью контактной разности потенциалов (V_{bi}) . Проведенное согласно [4] моделирование показало, что при увеличении температуры V_{bi} и W уменьшаются, а барьерная ёмкость увеличивается. Это обусловлено изменением степени заполнения глубоких уровней в области обеднения при изменении температуры. При этом выполняется соотношение $1/C^2 \sim W^2 \sim V_{bi}$ (рис. 1).

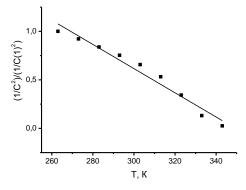


Рис. 1. Температурная зависимость относительной величины обратного квадрата барьерной ёмкости *p-i-n*-фотодиода. Сплошная линия – расчет

Зависимость C_{6} ot $V_{\mathsf{oбp}}$ p-i-nфотодиодов после облучения не изменила свой характер. Однако, как видно из представленного на рис. 2 относительного изменения барьерной емкости, в результате воздействия облучения у-квантами при напряжении внешнего смещения Vобр≤1 В происходит увеличение C_6 по сравнению с необлученными образцами. В то же время при $V_{\text{обр}}$ в диапазоне от 1 В до 20 В величина C_6 после облучения снизилась по сравнению с исходной. Поскольку размеры области пространственного заряда р-nперехода обратно пропорциональны его барьерной ёмкости ($W \sim 1/C_6$) [2], то, как видно из рис. 3, область обеднения в результате облучения изменила свою толщину. Причем для различных прикладываемых обратных напряжений эти относительные изменения так же, как и барьерная ёмкость, имеют различный характер. При напряжениях смещения менее 1 В

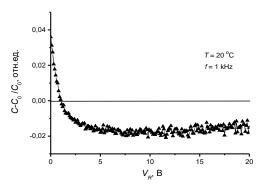


Рис. 2. Зависимость относительного изменения C_6 p-i-n-фотодиода от приложенного обратного напряжения после облучения γ -квантами 60 Со дозой 10^{15} квант/см 2

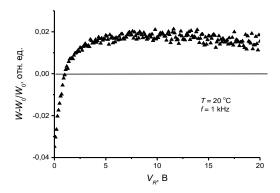


Рис. 3. Зависимость относительного изменения области обеднения p-i-n фотодиода от приложенного обратного напряжения после облучения γ -квантами 60 Со дозой 10^{15} квант/см 2

она уменьшилась, а при $V_{\rm oбp}$ свыше 1 В — возросла. Для объяснения наблюдаемых изменений C_6 и W в результате γ -облучения был проведен анализ поведения V_{bi} в соответствии с [2].

Установлено, что возрастание обратного тока p-i-n-фотодиодов в результате облучения γ -квантами, наблюдаемое ранее в [1], не может быть связано с компенсацией i-области и увеличением размеров W (при использованной дозе облучения концентрация основных носителей заряда снизилась только на $3.1\cdot10^{11}$ см⁻³, т.е. имеет место очень малое изменение концен-

трации свободных носителей заряда). Vbi в результате облучения уменьшилась на 0.0592 эВ, т.е. произошла компенсация основной легирующей примеси в базе диода вследствие генерации радиационных дефектов. Это привело к уменьшению W при $V_{\text{обр}} < V_{bi}$ и, как следствие, увеличению C_6 после облучения. При $V_{\rm obp} > V_{bi}$ вследствие компенсации радиационными дефектами і-области W обеднения увеличилась, а Сб соответственно уменьшилась. Основной причиной наблюдаемых эффектов является образование генерационнорекомбинационных центров радиационного происхождения вследствие конденсации первичных радиационных дефектов на технологических остаточных дефектах структуры. Данные технологические дефекты распределены неравномерно по объему базы р-і-п-фотодиодов как в исходных, так и в облученных приборах.

Заключение

Установлено, что изменения барьерной ёмкости p-i-n-фотодиодов при облучении γ -квантами определяются, прежде всего, величиной контактной разности потенциалов. При напряжении внешнего смещения $V_{06p} \le 1$ В происходит увеличение C_6 , при V_{06p} в диапазоне от 1 В до 20 В величина C_6 после облучения снизилась по сравнению с исходной.

Библиографические ссылки

- 1. Горбачук Н.И., Ластовский С.Б., Оджаев В.Б., Петлицкий А.Н., Просолович В.С., Ковальчук Н.С. и др. Влияние γ-облучения на вольтамперные характеристики *p-i-n-*фотодиодов. Материалы 13-й Международной научнотехнической конференции «Приборостроение 2020», Минск (18-20 ноября 2020 г.). Минск: БНТУ; 2020: 325-326.
- Sze S.M., Lee M.K. Semiconductor Devices: Physics and Technology. John Wiley & Sons Singapore Pte. Limited. 2012. 582 p.